# Synthèse de nanoparticules de GaN enterrées et propriétés d'émission optiques

Doctorant: AGGAR Lilia (Université Alger)

Directeurs de thèse:

- François LE NORMAND (Icube-MaCEPV/CNRS-Université de Strasbourg)

- Mehana ABDESSELAM (Université Alger)

Collaborations:

IPCMS/Strasbourg (C. Bouillet, P. Gilliot et M. Gallart)

Source Soleil (D. Bradai, D. Thiaudière)

Université Alger

# GaN

- Les films de GaN et Ga(Al, In)N sont liés au développement des dispositifs optiques et opto-électroniques dans le bleu et l'UV car
  - Gap important (3,47 eV pour GaN)
  - Forte inertie chimique
  - Bonnes propriétés mécaniques et thermiques
- Les nanoparticules sont également très étudiées, mais plus récemment, pour détecteurs (optoelectronique intra rouge; UV, biodetecteurs...), photovoltaique, LED, transistors, etc..
- Des effets de confinement quantique sont attendus en deçà de 3 nm

# Implantation ionique dans les matériaux photo-voltaiques



Substrat de Silicium

**Objectifs (en fonction de la littérature...):** 

> Etudier la diffusion du Ga dans le  $Si_3N_4$  et  $SiO_2$ .

Réaliser des nanoparticules de GaN en utilisant un procédé original.

> Mesurer les propriétés optiques

### Avantages de la méthode d'implantation

- Compatibilité avec la technologie du silicium
- Absence d'interaction et de dégradation avec un environnement gazeux agressif
  - Réseaux 3D avec une très grande densité d'éléments actifs
- Dosage précis de la profondeur d'implantation et de la densité des implants



Comparaison systématique SiO2(GaN)/Si(100) et cat/SiO2(GaN)/Si(100)

### Intérêt catr<sup>0</sup> à la surface : active la décomposition atomique du diazote même en présence d'hydrogène



 $N_2(g) \longrightarrow 2N(ads) + 6H(ads) sur (cat<sup>0</sup>)$ 

 $N_2(g) + 3H_2(g) \leftarrow ----- 2NH_3$  sur (cat<sup>0</sup>) au delà de 450K et dépend Pression

- $2N(ads) \rightarrow 2N(abs)$  Bulk diffusion
- 2N(abs) + Ga(impl) ---> GaN (impl)
- $2N(impl) + Ga(impl) \rightarrow GaN(impl)$

**Conclusions** : on peut travailler sous  $N_2(g)$  ou  $N_2(g) + 3H_2(g)$  au-delà de 450K





SiO2(GaN)/Si(100) et cat/SiO2(GaN)/Si(100)

#### analyse RBS des échantillions avec et sans catalyseur



GaN plus intense en présence de catalyseur

#### Analyse par spectroscopie Raman



Pic Raman plus intense correspondant à GaN sur cat/SiO2/Si(100)

#### TEM échantillons SiO2(GaN)/Si(100): (GaN) mais aussi (Ga<sup>0</sup>, Ga2O3)





#### TEM: Cat/SiO2(GaN)/Si(100) GaN uniquement





#### Photoluminescence à 20-300K



2,5 Energie (eV) 3,0

3,5

2,0

Emission jaune liée à des défauts dans GaN

Emission très intense bleue (3,40eV) liée à meilleure cristallinité de GaN?

## Photoluminescence à 20 K

- 2.7-3.5 eV: Nombreuses contributions de transitions impliquant des états excitonique libres ou liés, des niveaux accepteurs ou donneurs (profonds ou superficiels)
- < 2.7 eV : Emission "jaune" liée au défaut structuraux, centres de recombinaison radiative



### Conclusions

- Nanoparticule de GaN implantées
- Traitées par thermocatalyse en environnement d'azote
- Propriétés d'émission optiques d'émission excitoniques à bandes étroites très caractéristiques d'un matériau structurellement propre
  - Autres matrices (DLC)
  - Baisser la temperature de traitement
- Passer aux alliages ternaires Ga(In)N pour controler la longueur d'émission
  - Controler la densité
  - Meilleure resolution en PL
  - Trouver une application.....